

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成20年11月13日(2008.11.13)

【公開番号】特開2002-201242(P2002-201242A)

【公開日】平成14年7月19日(2002.7.19)

【出願番号】特願2001-296000(P2001-296000)

【国際特許分類】

C 08 F 291/00 (2006.01)

C 08 F 2/44 (2006.01)

【F I】

C 08 F 291/00

C 08 F 2/44 C

【手続補正書】

【提出日】平成20年9月26日(2008.9.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0039

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0039】

実施例3：

反応物質	量(g)
A M P S	80
醋酸ビニル	20
シクロヘキサン	200
水	300
(^R) Span 80	1
Na ₂ S ₂ O ₈ (開始剤)	1
ポリ[N-ビニルピロリドン- <u>コーアクリル酸</u>] (30/70)	4

ポリマーを水中で乳化重合法によって製造する。この場合にはモノマーを水 / シクロヘキサンに(^R)Span 80の使用下に乳化し、反応混合物をN₂で不活性化し、次いで反応を加熱後にペルオキソ二硫酸ナトリウムの添加によって開始する。ポリマーエマルジョンを次いで蒸留濃縮しそしてそれによってポリマーを単離する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0040

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0040】

実施例 4 :

反応物質	量 (g)
NH ₃ で中和した AMPS	80
第三ブタノール	300
N-ビニルホルムアミド	20
TMP TA	1.8
ABAH (開始剤)	1
ポリN-ビニルカプロラクトン - <u>コ</u> -アクリル酸 (10 / 90)	<u>10</u>

ポリマーを第三ブタノール中で沈殿法によって製造する。この場合にはモノマーを第三ブタノールに最初に導入し、反応混合物を不活性化し、次いで反応を加熱後にABAHの添加によって開始する。ポリマーを溶剤の吸引濾去および続いての減圧乾燥によって単離する。